PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-283093

(43) Date of publication of application: 02.10.2002

(51)Int.CI.

B23K 35/26 C22C 13/00

(21)Application number: 2001-090051

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

27.03.2001

(72)Inventor: TADAUCHI KIMIHIRO

KOMATSU IZURU

TATEISHI HIROSHI TEJIMA KOICHI

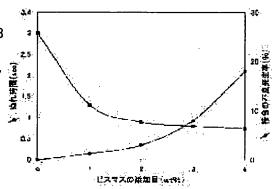
MATSUMOTO KAZUTAKA

YOSHIKI MASAHIKO YABUKI MOTOO SUZUKI ISAO

(54) ALLOY FOR JOINING LEAD-FREE SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an alloy for connecting a lead-free system which is good in characteristics, such as wettability and material strength, and is high in workability and yield. SOLUTION: This alloy for joining the lead-free system contains ≥3 to ≤12 wt.% zinc and over 1 wt.% and below 3 wt.% at least one kind selected from bismuth, silver, aluminum, magnesium, nickel, manganese, silicon, copper, zirconium, germanium and niobium and consisting of the balance substantially tin. This alloy for joining the leadfree system includes a zinc phase and contains at least one kind selected from the group described above at <3 wt.% in this zinc phase.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.04.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-283093 (P2002-283093A)

(43)公開日 平成14年10月2日(2002.10.2)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FI

テーマコート*(参考)

B 2 3 K 35/26

3 1 0

B 2 3 K 35/26

310A

C 2 2 C 13/00

C 2 2 C 13/00

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 6 頁)

(21	۱ μ	日米面

特願2001-90051(P2001-90051)

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

(22)出願日

平成13年3月27日(2001.3.27)

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(72)発明者 忠内 仁弘

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社東芝横浜事業所内

(72) 発明者 小松 出

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株

式会社東芝横浜事業所内

(74)代理人 100083161

弁理士 外川 英明

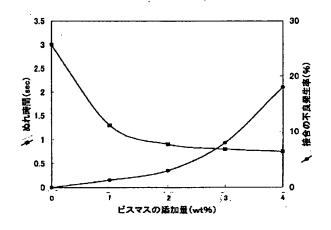
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 非鉛系接合用合金

(57)【要約】

【課題】 ぬれ性、材料強度等の特性が良好で、作業性、歩留まりの高い非鉛系接続用合金を提供する。

【解決手段】 本発明は、亜鉛が3wt%以上12wt%以下含まれ、ビスマス、銀、アルミニウム、マグネシウム、ニッケル、マンガン、ケイ素、銅、ジルコニウム、ゲルマニウム、及びニオブよりなる群から選択される少なくとも1種が1wt%を超え3wt%未満含まれ、残部が実質的に錫からなる非鉛系接合用合金であって、この非鉛系接合用合金が亜鉛相を含み、この亜鉛相中に前記群から選択される少なくとも1種を3wt%未満含むことを特徴とする非鉛系接合用合金を提供する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 亜鉛が3wt%以上12wt%以下含まれ、ビスマス、銀、アルミニウム、マグネシウム、ニッケル、マンガン、ケイ素、銅、ジルコニウム、ゲルマニウム、及びニオブよりなる群から選択される少なくとも1種が1wt%を超え3wt%未満含まれ、残部が実質的に錫からなる非鉛系接合用合金であって、この非鉛系接合用合金が亜鉛相を含み、この亜鉛相中に前記群から選択される少なくとも1種を3wt%未満含むことを特徴とする非鉛系接合用合金。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、非鉛系接合用合金 に関する。

[0002]

【従来の技術】ある物体と、その物体よりも融点の低い物質を用いた接合技術としてのはんだ付けは古くから用いられている。

【0003】現在においても、はんだは電子機器の接合に使用されており、実装基板における半導体、マイクロプロセッサー、メモリー、抵抗などの電子部品と基板との接合をはじめとして幅広く用いられている。

【0004】はんだの長所は、部品を基板に固定するだけではなく、導電性を有する金属をはんだに含有させることにより、有機系の接着剤とは異なり電気的接合も兼ね備えている点にある。今日、パーソナルコンピューターや携帯電話などに代表されるパーソナル機器の急激な普及が進むにつれ、電子部品の実装技術におけるはんだ接合は、ますますその重要性が増してきている。

【0005】はんだとして、現在最も多く用いられてい 30 るのは、錫と鉛を用いた共晶はんだであり、銅板に対するぬれ性が、他の金属混合物よりも優れているという性質を持つ。ところがこの錫・鉛系合金に含まれる鉛は、人体に対して有害性を有しており、現在、鉛を含まない鉛フリーはんだの開発が急務とされている。

【0006】鉛フリーはんだとして有望視されているのは、現行の錫・鉛系合金の融点に近く、電子部品の熱損傷を防ぐことの可能な錫・亜鉛系合金である。さらに、錫・亜鉛系合金の中でも、錫・亜鉛二元合金にビスマスを約3%添加したはんだは作業性が高く、好ましいとさ40れている。

【0007】しかしながら、これらの材料を用いたはんだは、ぬれ性、接合強度等の特性が未だ錫・鉛系合金に比べて劣っており、さらなる開発が求められている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】上述したように、電子 部品の接合の際に用いるはんだとして良好な特性を有す る錫・鉛合金は、鉛に有害性があるため、好ましくな い。鉛フリーはんだとして有望とされている、錫・亜鉛 系合金も、ぬれ性、接合強度等の特性において、未だ錫 50 ・鉛合金に比べて劣っており、さらなる開発が求められ る。

【0009】これらの問題に鑑み、本発明は、ぬれ性、 材料強度等の特性の良好な錫・亜鉛系の非鉛系接合用合 金を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】そこで本発明は、亜鉛が 3 w t %以上1 2 w t %以下含まれ、ビスマス、銀、アルミニウム、マグネシウム、ニッケル、マンガン、ケイ素、銅、ジルコニウム、ゲルマニウム、及びニオブより なる群から選択される少なくとも1種が1 w t %を超え 3 w t %未満含まれ、残部が実質的に錫からなる非鉛系接合用合金であって、この非鉛系接合用合金が亜鉛相を含み、この亜鉛相中に前記群から選択される少なくとも1種を3 w t %未満含むことを特徴とする非鉛系接合用合金を提供する。

[0011]

【発明の実施の形態】ぬれ性、材料強度等の特性の良好な非鉛系接合用合金を得る為に、本発明者らは、亜鉛を約3wt%以上約12wt%以下含み、ビスマス、銀、アルミニウム、マグネシウム、ニッケル、マンガン、ケイ素、銅、ジルコニウム、ゲルマニウム、及びニオブよりなる群から選択される少なくとも1種を約1wt%を超え約3wt%未満含み、残部が実質的に錫からなる非鉛系接合用合金が亜鉛を主成分とする領域である亜鉛相を含み、この亜鉛相が上記の群から選択される少なくとも1種を約3wt%未満含むことが好ましいことを見出した。

【0012】本発明の非鉛系接合用合金には、2つのタイプがある。

【0013】第1のタイプは、亜鉛を約3wt%以上約12wt%以下含み、ビスマス、マグネシウムから選択される少なくとも1種を約1wt%を超え約3wt%未満含み、残部が実質的に錫からなる非鉛系接合用合金であって、この非鉛系接合用合金が亜鉛相を含み、この亜鉛相がビスマス、マグネシウムから選択される少なくとも1種を約3wt%未満含むものである。

【0014】錫・亜鉛系の非鉛系接合用合金に、ビスマス、マグネシウムを添加した場合は、錫の中にビスマス、マグネシウムが固溶し、表面張力が低下する。また、ビスマス、マグネシウムは融点が低く、これらを含んだ非鉛系接合用合金は溶解の速度が上昇する。これらのことにより、ぬれ広がりの速度が増大し、良好なぬれ性を有する非鉛系接合用合金を得ることが出来る。

【0015】図1は、錫・亜鉛系の非鉛系接合用合金に ビスマスを添加した場合の、ビスマスの添加量に対する この合金のぬれ時間、及びはんだ接合後の不良発生率を 示す特性図である。ただし、この非鉛系接合用合金の亜 鉛濃度を約9 w t %とし、亜鉛、ビスマス以外は実質的 に錫からなるものとする。図1に示すように、非鉛系接

2

合用合金にビスマスを添加した場合、ビスマスの添加量が約1 w t %を超えると、ビスマスが錫中に固溶することから表面張力が低下し、この合金を加熱した際のぬれ時間が短くなる。約1 w t %以下では、ビスマスを添加した効果が十分に現れずにこの合金のぬれ時間が長くなり、好ましくない。これは、ビスマスを用いる代わりにマグネシウムを用いた場合も同様である。

【0016】また、図1に示すように、この錫・亜鉛系合金に対するビスマスの添加量を約3wt%以上とすると、この非鉛系接合用合金を用いたはんだ接合後の不良発生率が上昇するために歩留まりが低下し、好ましくない。これは、ビスマスの脆性が高い為に、高濃度の添加を行うと、不良発生率が上昇するのである。

【0017】一般に多結晶の場合、結晶粒界を挟んで両 側の結晶方位が異なるためすべり面が不連続になり、転 移の運動が結晶粒界で阻止されて、単結晶とは異なる塑 性挙動を示すようになる。そして、多結晶の場合、結晶 粒界では原子配列が大きく乱れ、隙間も多いことから拡 散が起こりやすく、強度に対して弱化の効果をもたら す。本発明のようにビスマスの約3wt%未満の添加 は、組織の微細化をもたらし強度を改善するが、約3w t%以上の多量の添加は組織に脆さをもたらすことから 粒子そのものの歩留まりの低下をもたらす。これは、ビ スマスを用いる代わりにマグネシウムを用いた場合も同 様である。第2のタイプは、亜鉛を約3wt%以上約1 2wt%以下含み、銀、アルミニウム、ニッケル、マン ガン、ケイ素、銅、ジルコニウム、ゲルマニウム、及び ニオブよりなる群から選択される少なくとも1種を約1 wt%を超え約3wt%未満含み、残部が実質的に錫か らなる非鉛系接合用合金であって、この非鉛系接合用合 金が亜鉛相を含み、この亜鉛相が上記の群から選択され る少なくとも1種を約3wt%以下含むものである。上 記の群から選択される少なくとも1種を添加した場合に は、この非鉛系接合用合金の結晶組織が緻密になること から、接合強度が上昇し、良好な特性を有する非鉛系接 合用合金を得ることが出来る。

【0018】ただし、銀、アルミニウム、ニッケル、マンガン、ケイ素、銅、ジルコニウム、ゲルマニウム、及びニオブよりなる群から選択される少なくとも1種を添加する場合も、添加量が約1wt%以下では、これらが錫中に固溶して結晶組織を緻密にする、十分な効果を得ることが出来ない。また、添加量を約3wt%以上とすると、これらが非鉛系接合用合金の融点を上昇させる為に、接合温度が高くなり接合の際に電子部品等を傷める可能性があり、好ましくない。

【0019】また、第1のタイプ、第2のタイプの双方において、これらの非鉛系接合用合金の結晶構造は、図2の模式図に示すように、亜鉛を主成分とする針状(棒状)組織である亜鉛相21の周りを合金相22が取り囲む、共晶組織に似た構造を示す。本発明においては、こ

の亜鉛相21中のビスマス、銀、アルミニウム、マグネシウム、ニッケル、マンガン、ケイ素、銅、ジルコニウム、ゲルマニウム、及びニオブよりなる群から選択される少なくとも1種の濃度を約3wt%以下とすることが望ましい。上記の群から選択される少なくとも1種は、錫中に固溶することにより表面張力の低下、結晶組織の緻密化等の効果が得られるものであり、亜鉛相21中にこれらが含まれることは好ましくない。従って、亜鉛相21中のこれらの濃度が約3wt%以上であると、合金相22中に固溶するこれらの量が少ない為、上述したような、表面張力を低下させる、結晶組織を緻密にする等

【0020】以下に、本発明の各実施形態を詳細に説明 するが、本発明はこれらの実施形態に限定されるもので はない。

の効果を得ることが困難になる。

【0021】(第1の実施形態)本発明の第1の実施形態について説明する。本実施形態の非鉛系接合用合金は、亜鉛及び錫を主成分とし、ビスマスを約2.0wt%添加するものである。

【0022】本実施形態の非鉛系接合用合金を、製造方法に沿って説明する。

【0023】はんだ溶融槽内に、極低酸素状態において作成した、錫が約88.9wt%以上、亜鉛が約9.0wt%、ビスマスが約2.0wt%、その他の不可避な成分が約0.1wt%未満の組成比である合金を入れ、はんだ溶融槽の外壁に巻きつけたヒーターを用いて加熱する。はんだ溶融槽内の温度が約220℃に達したところで保持し、完全に固形物を溶融させる。この合金が溶融した時点で、すばやく表層部にHot Air Leveling(HAL)処理用のフラックスとして、メック社製のW-2704を用いて、数mm程度の厚さとなるよう被覆し、溶融物と大気が接触しないようにす

【0024】次に、溶融物を、常に一定量が滞留可能となるようなセル中に導き、約1kHzの弾性波をこの溶融物に印加しながら、セルの下部に直結したノズルから、一定間隔で噴射する。溶融物は、重力の作用でノズルの下方にある鉱油が満たされた冷却槽内に落下する。この冷却槽内に満たされた鉱油は、冷却槽上部では約20 ∞ 0 ∞ 0 個度に、また最下部は常温に保たれており、溶融物は冷却槽中を沈殿しながら球体化し、最下部に達したところで完全に固化する。得られた粒子50 個の平均粒径は約 25μ m ∞ 約 45μ m ∞ 0

【0025】 冷却後、固化した粒子に対し、オージェ電子分光法による深さ方向の解析を、粒子の中心軸について約800nmの深さまで実施した。その結果、図3の断面図に示すように、この粒子の最表面に約12nmの厚さの酸化層31が、この酸化層31の直下に約10nmの厚さのビスマスが濃化した濃化層32が形成され、さらにこの濃化層32の内側に錫と亜鉛とビスマスがほ

ぼ一定の割合で存在している錫・亜鉛・ビスマス合金層 33が存在していることが分かった。ビスマスが亜鉛よ りも酸素親和力が高いことから、この濃化層32は亜鉛 と酸素との結びつきを抑制し、酸化層31を薄くする。 【0026】さらに、この粒子の酸化層31の表面に は、わずかな炭素の付着があり、大気中から他の成分が 内部へ浸透するのを防いでいるのが分かった。また、酸 化層31も、これより内部へ酸素が浸透するのを防いで いる。

【0027】次に、得られた粒子を用いフラックスと混 10 合して、錫・亜鉛・ビスマスソルダーペーストを作成す る。フラックスとしては、重合ロジン(松脂)約46重

る。

[0029]

[基板仕様]

片面実装評価用ガラエポ基板

寸法 : 約180mm×約200mm×約1.6mm

電極 : 銅メッキ プリフラックス塗布

電極パターン : 25pin×4 QFP対応パターン

パッドピッチ : 約0.5mm

基板搬送スピード : 約0.8 m/min

その結果、ブリッジやはんだボールもなく、はんだ付け 20 することが出来た。また、はんだ付けの後、測定数を1 Oとして、QFPのピンの接合強度を測定したところ、 本実施形態においては、従来の錫・鉛共晶ソルダーペー ストにより実装した場合と比較して作業性は同等であ り、接合強度は錫・鉛共晶ソルダーペーストの場合の、 約1. 2倍から約1. 4倍の値を有していた。

【0030】これらのことから、本実施形態により、接 合強度が大きく、歩留まりが高く、ぬれ広がりの向上し た、作業性の高い非鉛系接続用合金を提供することが可 能となる。

【0031】 (第2の実施形態) 本発明の第2の実施形 態について説明する。本実施形態の非鉛系接合用合金 は、第1の実施形態と同様の組成の金属、方法を用い て、同様に粒子を形成するが、これらの金属を溶融した 後に粒子を形成する際の、ノズルからの噴射の条件を第 1の実施形態とは異なるものとし、この粒子の粒径の平 均値を、約760 μ m とする。また、この粒子の断面 は、第1の実施形態と同様、図3のように示される。

【0032】本実施形態において、非鉛系接合用合金の 粒子を用いて接合を行う方法としては、CSP用のパッ 40 ケージの、あらかじめフラックスを塗布した電極上にこ の粒子をのせ、従来と同様、ピーク温度を約230℃と してリフローする。

【0033】その結果、ブリッジやはんだボールもな く、はんだ付けすることが出来た。また、はんだ付けの 後、測定数を5として、ピンの接合強度を測定したとこ ろ、本実施形態においては、従来の錫・鉛共晶はんだ粒 子により実装した場合と比較して作業性は同等であり、 接合強度は錫・鉛共晶はんだ粒子の場合の、約1.0倍 から約1. 2倍の値を有していた。

量部、溶剤(主成分:テルピネオール)約44.5重量 部、硬化ヒマシ油(チキソ剤)約8重量部、活性剤(主 成分:ジフェニルグアニジン臭化水素酸塩)約0.9重 量部、パルミチン酸約0.3重量部及びエチルアミン塩 酸塩約0.3重量部とを混合しながら加熱した後に冷却 して調製すれば良い。

【0028】このソルダーペーストを、ステンレス製の スクリーンを用いて、以下の仕様の基板に約150μm の厚さとなるよう印刷した後、QFPをマウントし、従 来と同様にピーク温度を約230℃としてリフローす

【0034】これらのことから、本実施形態において も、接合強度が大きく、歩留まりが高く、ぬれ広がりの 向上した、作業性の高い非鉛系接続用合金を提供するこ とが可能であるといえる。

【0035】 (第3の実施形態) 本発明の第3の実施形 態について説明する。本実施形態の非鉛系接合用合金 は、亜鉛及び錫を主成分とし、ケイ素を約1.5wt% 添加したものである。

【0036】本実施形態の非鉛系接合用合金は、ビスマ スではなくケイ素を添加する点が第1の実施形態とは異 なるものであり、この合金の組成比を、錫を約89.4 w t %以上、亜鉛を約9. 0 w t %、ケイ素を約1. 5 w t %、その他の不可避な成分を約0.1 w t %未満と して、第1の実施形態と同様の方法を用いて粒子を形成 する。その際、これらの金属を溶融した後に粒子を形成 する際の、ノズルからの噴射の条件を第1の実施形態と は異なるものとし、この粒子の粒径の平均値を、約76 0μmとする。

【0037】また、この粒子の断面構造は、第1の実施 形態と同様、図3のように示されるが、図3において酸 化層31の直下に形成されるのはケイ素の濃化した濃化 層32である。さらに、この粒子の酸化層31の厚さは 約12nmであり、濃化層32の厚さは約8nmであっ た。また、本実施形態においても、酸化層31の直下に 亜鉛よりも酸素との親和力が大きいケイ素の濃化層32 が形成されることから、この濃化層32が亜鉛と酸素と の結びつきを抑制して、酸化層31の厚さが薄くなる。

【0038】本実施形態において、非鉛系接合用合金の 粒子を用いて接合を行う方法としては、CSP用のパッ ケージの、あらかじめフラックスを塗布した電極上にこ 50 の粒子をのせ、従来と同様、ピーク温度を約230℃と

してリフローする。

【0039】その結果、ブリッジやはんだボールもなく、はんだ付けすることが出来た。また、はんだ付けの後、測定数を5として、ピンの接合強度を測定したところ、本実施形態においては、従来の錫・鉛共晶はんだ粒子により実装した場合と比較して作業性は同等であり、接合強度は錫・鉛共晶はんだ粒子の場合の、約1.0倍から約1.2倍の値を有していた。

【0040】これらのことから、本実施形態において も、接合強度が大きく、歩留まりが高く、ぬれ広がりの 10 向上した、作業性の高い非鉛系接続用合金を提供するこ とが可能であるといえる。

[0041]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によって、 ぬれ性、材料強度等の特性が良好で、作業性、歩留まり の高い非鉛系接続用合金を提供することが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の非鉛系接合用合金の特性図である。

【図2】 本発明の非鉛系接合用合金の粒子内部の模式 図である。

【図3】 本発明の非鉛系接合用合金の粒子の断面の模式図である。

【符号の説明】

2 1 …亜鉛相

22…合金相

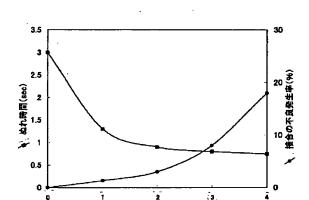
23…結晶粒界

3 1 …酸化層

3 2…濃化層

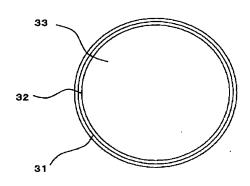
33…錫・亜鉛・ビスマス合金層

【図1】

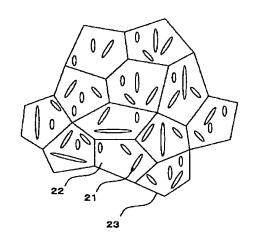


ビスマスの添加量(wt%)

[図3]



【図2】



フロントページの続き

 $\varphi(x) = x - x$

(72) 発明者 立石 浩史 (72)発明者 吉木 昌彦 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝横浜事業所内 式会社東芝研究開発センター内 (72) 発明者 手島 光一 (72) 発明者 矢吹 元央 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝横浜事業所内 式会社東芝研究開発センター内 (72)発明者 松本 一高 (72) 発明者 鈴木 功 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内 式会社東芝研究開発センター内